

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 09-034106

(43)Date of publication of application : 07.02.1997

(51)Int.Cl.

G03F 7/004

G03F 7/027

G03F 7/028

G03F 7/26

(21)Application number : 07-184065

(71)Applicant : TOPPAN PRINTING CO LTD

(22)Date of filing : 20.07.1995

(72)Inventor : ITO HIROMITSU

OE YASUSHI

ICHIMURA KUNIHIRO

(54) PHOTOPOLYMERIZABLE COMPOSITION AND METHOD FOR POLYMERIZING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a photopolymerizable compsn. propagating an acid in a large quantity under a small quantity of radiation having a chemical action and ensuring a remarkably increased rate of sensitization and to provide a method for polymerizing the compsn.

SOLUTION: A cationic addition-polymerizable compd. is combined with a photo-initiator for cationic polymn. generating Bronsted acid or Lewis acid which activates cationic polymn. under radiation having a chemical action and a substance newly generating such an acid from the generated acid to obtain the objective photopolymerizable compsn. ensuring a remarkably increased rate of sensitization. When a hybrid photopolymerizable compsn. is produced by combination with a radical-polymerizable compd., the rate of sensitization can further be increased.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

12.06.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.*** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] (A) A photopolymerization nature constituent characterized by consisting Broensted acid generated from a compound in which cationic polymerization is possible, an optical initiator for cationic polymerization which generates Broensted acid or Lewis acid which activates cationic polymerization with (B) chemical action radiation, and optical (C) this initiator, or Lewis acid of an acid growth agent which newly generates an acid as a catalyst.

[Claim 2] A photopolymerization nature constituent characterized by the following (A) A polymerization nature monomer which has a compound in which cationic polymerization is possible, an optical initiator for cationic polymerization which generates Broensted acid or Lewis acid which activates cationic polymerization with (B) chemical action radiation, an acid growth agent which newly generates an acid for Broensted acid generated from optical (C) this initiator, or Lewis acid as a catalyst, and at least one or more ethylene nature unsaturated bonds in which the (D) radical polymerization is possible And a compound which generates a radical kind which makes generating of Broensted acid or Lewis acid which the optical (aforementioned B) initiator for cationic polymerization makes activate cationic polymerization with chemical action radiation, and coincidence activate a radical polymerization

[Claim 3] A photopolymerization nature constituent according to claim 1 or 2 which comes to contain sensitizing dye which carries out sensitization of the optical initiator for cationic polymerization which generates Broensted acid or Lewis acid which it has [Lewis acid] absorption to a light field, and activates cationic polymerization with (B) chemical action radiation, and is characterized by cationic polymerization being possible with chemical action radiation of a visible region.

[Claim 4] (A) A photopolymerization nature constituent according to claim 1 to 3 characterized by a compound in which cationic polymerization is possible being a compound which has an epoxy group.

[Claim 5] (A) A photopolymerization nature constituent according to claim 1 to 3 characterized by a compound in which cationic polymerization is possible being a vinyl ether compound.

[Claim 6] A polymerization method characterized by coming to carry out the polymerization of the photopolymerization nature constituent at a quick sensitization speed by heat-treating in 50 to 200 degrees C as only down stream processing after irradiating chemical action radiation at a photopolymerization nature constituent according to claim 1 to 5.

[Claim 7] A photopolymerization nature constituent characterized by having applied on a substrate sensitization liquid which dissolves in a solvent and it comes to prepare, having dried under existence of an acid with a high molecular compound which does not cause chemical reactions, such as decomposition or a polycondensation, and making a photopolymerization nature constituent according to claim 1 to 5 into the shape of a solid.

[Translation done.]

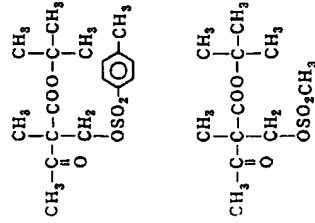
(5)

7
 ができるが、これらに限定されるものではなく、また2種類以上を混合して用いても構わない。

【0022】上記のこれらにカチオン重合用光増感剤のうち、ジフェニルヨードニウム、ジトリルヨードニウム、フェニル (p-アニシル) ヨードニウム、ビス (m-ニトロフェニル) ヨードニウム、ビス (p-tert-ブチルフェニル) ヨードニウム、ビス (p-クロロフェニル) ヨードニウムなどのヨードニウムのクロロド、ブロミド、あるいはホウフウ化塩、ヘキサフルオロオキサフェート塩、ヘキサフルオロセネート塩等のヨードニウム塩、およびトリアリールスルホニウム塩、トリアリールボスホニウム塩、鉄アレーン錯体などは、同時にラジカル重合を活性化させるラジカル種を発生し、ラジカル重合可能なエチレン性不飽和結合を少なくとも1個以上有する重合性モノマーの重合を開始することができる化合物である。

【0023】さらに、本発明の成分 (C) 光増感剤より発生したブレンステッド酸またはルイス酸が触媒となし、新たに酸を発生する増殖触媒は、比較的強い酸の残基で置換された化合物であって、酸触媒の存在下で容易に脱離して新たに酸を発生する化合物である。すなわち酸触媒反応によって分解し、再び酸 (以下、一般式でZOHと記す。) を発生する、一反応で一つ以上の酸が増え、反応の進行によって加速的に酸濃度が増加することにより、飛躍的に光速度が向上する重合性組成物を得ることができる。この発生する酸の強度は酸解離定数 (pKa) として3以下であり、さらに2以下で安定することが好ましい。このよりも強い酸であれば、酸触媒による脱離反応を引き起こすことができる。このような酸触媒に用いられることは、ジクロロ酢酸、ト

* 30



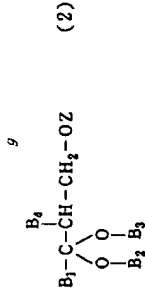
【0029】第2の具体例としては、一般式 (2) で表されるアセタールまたはエタール基を持つ有機酸エステルを挙げることができる。

【0030】

【化3】

* 40

(6)



【0031】(式中、ZはpKaが3以下であるZOHで表される酸の残基を示し、B₁は水素原子、アルキル基あるいはアリール基であり、B₂ およびB₃ はメチル基あるいはエチル基または阿若でエチレンまたはプロピレン基を形成するものであり、B₄ は水素原子またはメチル基を示す。)

【0032】これらの化合物は酸の作用でアセタールあるいはエタールが分解してβ-アルデヒドあるいはケトンとなり、これからZOHが容易に脱離する。具体的な例を以下に示す。

【0033】

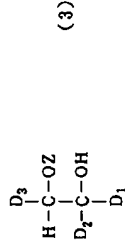
【化4】



【0034】第3の具体例は、一般式 (3) で表される有機酸エステルの挙げるができる。

【0035】

【化5】



【0036】(式中、ZはpKaが3以下であるZOHで表される酸の残基を示し、D₁、D₂、D₃ は炭素原子数 (C) 1から6までのアルキル基または双方が脂環状構造を形成するアルキレン或いは置換アルキレン残基を示し、D₂は水素原子、炭素原子数 (C) 1から6までのアルキル基またはアリール基を示す。)

【0037】これらの化合物は、酸触媒によって水酸基が脱離してカルボカチオンを形成し、水素移動をしてからZOHが発生するものと推定される。具体的な例を以下に示す。

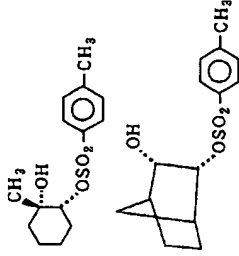
【0038】

【化6】

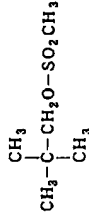
* 50

【0044】これらの化合物は酸が作用しない限り室温で安定に存在する。これらの化合物が酸触媒の存在下で分解するためには一定以上の酸強度が必要となるが、pKaで3以下であり、さらに好ましくは2以下であることが望ましい。これ以上のpKa、すなわち、これ以上弱い酸であれば、酸増強剤の反応を引き起こすことができない。

10



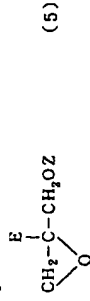
10



【0039】第4の具体例は、一般式 (4) で表されるエポキシ環を有する有機酸エステルを挙げることができる。

【0040】

【化7】

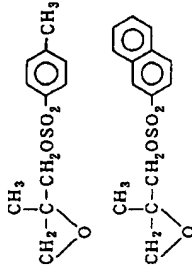


【0041】(式中、ZはpKaが3以下であるZOHで表される酸の残基を示し、Eは炭素原子数 (C) 1から6までのアルキル基またはフェニル基を示す。)

【0042】これらの化合物に酸が作用するとエポキシ環の開裂が起こり、β-炭素にカチオンが形成され、水素移動の結果として有機酸が発生するものと推定される。具体的な例を以下に示す。

【0043】

【化8】



* 60

(9)

15

を増感可能な色素を添加し、可視領域の化学作用放射線によりカチオン重合可能な場合、増感色素の添加量は通常カチオン重合可能な化合物(A)100重量部に対して、0.1から10重量部、さらに好ましくは0.5から5重量部の範囲で用いることができる。なお、増感色素の使用量は光重合性組成物の照射する化学放射線の過剰によって制限を受け、その過剰率が10%以下になるまで、見かけの感光度が低下する問題を有する。

【0058】加えて、光重合性組成物を、酸の存在下で分解あるいは重合等の反応を起こさない高分子化合物と共に溶解して、製してなる感光液を基板上に塗布、乾燥して固形状とすることができ、このような高分子化合物としては、ポリメタクリル酸エステル、ポリアクリル酸エステルおよびそれらの部分加水分解物、ポリ酢酸ビニル、ポリマシレン、ポリビニルブチラール、ポリビニルアセタール、ポリビニルアセテート、ポリビニルアルコール、ポリクロロブレン、ポリ塩化ビニル、セルロースアセテート、セルロースアセチレート、メチルセルロース、エチルセルロース、塩素化ポリエチレン、塩素化ポリプロピレン、ポリ-N-ビニルカバゾール、ポリ-N-ビニルピロリジン、ポリ酢酸/アクリル酸ビニル、ポリ酢酸/メタクリル酸ビニル、エチレン/酢酸ビニル重合体およびスチレン、無水マレイン酸、アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸エステル、メタクリル酸メタクリル、アクリルアミド、メタクリルメタクリル等の共重合体モノマーから成る重合体などを挙げることができる。これらは、必要に応じて2種類以上混合して用いても構わない。

【0059】また本発明は、光重合性組成物を酸の存在下で分解あるいは重合等の化学反応を起こさない高分子化合物と共に固形状として用いる場合、高分子化合物の添加量は、通常カチオン重合可能な化合物(A)100重量部に対して、200重量部以下であることが好ましい。これ以上の割合で用いると、カチオン重合可能な化合物の放射が抑制され、光速度に悪影響を及ぼす問題を有する。

【0060】本発明の光重合性組成物の硬化に使用する化学作用放射線の光源としては、超高压水銀灯、高圧水銀灯、低圧水銀灯、カーボンアーク灯、キセノン灯、メタルハライドランプ、ヘリウム・カドミウムレレーザ、アルゴンレレーザ、クリプトンレレーザ、ヘリウムネオンレレーザ等があるが、これらに用いられるものではない。なお、化学作用放射線の波長は使用される光開始剤によって定まる。

【0061】本発明の光重合性組成物によれば、少量の化学作用放射線の照射エネルギーによりカチオン重合光開始剤の分解が起こり、カチオン重合を活性化させるプレンステッド酸若しくはリルイス酸を生ずる。その後、適当な温度(50℃±0.0℃)で適当な時間(3

16

0秒以上)加熱することにより、酸増殖剤の連鎖的な分解で酸触媒の増加がねずみ算的に促進されると共に、酸触媒反応によってカチオン重合可能な化合物の重合が加速的に起こる。この結果、見かけの感光度が促進されると推測される。また、カチオン重合光開始剤の分解によってプレンステッド酸若しくはリルイス酸の発生と同時にラジカル重合を活性化させるラジカル種を生ずる化合物を用いた場合、本発明の光重合性組成物に適当量のラジカル重合性モノマーを添加することにより一層の感光度の向上が見られるものと思われる。さらに、増感剤の添加により可視領域の化学作用放射線による重合反応も可能となる。

【0062】

【実施例】以下、具体的な実施例を挙げ、本発明をさらに詳細に説明する。まず、本発明中で用いられる代表的な酸増殖剤の合成例を示す。

【0063】(1)アセト酢酸tert-ブチルエステルをテトラヒドロフラン中水素化ナトリウム存在下でヨウ化メチルと反応させて得られる2-メチル-3-ケトブタン酸tert-ブチルエステルを、エタノール中水素化カリウム存在下でホルマリンと反応させた。生成した2-ヒドロキシメチル-2-メチル-3-ケトブタン酸tert-ブチルエステルをジクロロメタン中トリエチルアミン存在下でp-トルエンスルホンクロライドと反応させて、2-メチル-2-(p-トルエンスルホンホルニルオキシ)-3-ケトブタン酸tert-ブチルエステル(CAG1)を得る。

【0064】(2)上記のCAG1と同様に、p-トルエンスルホンホルニルクロライドの代わりにメタンスルホンクロライドを用いて、2-メチル-2-メタンスルホンホルニルオキシ-3-ケトブタン酸tert-ブチルエステル(CAG2)を得る。

【0065】(3)ジクテンを酢酸ナトリウムを触媒として2-フェニル-2-プロパノールと反応させてアセト酢酸2-フェニル-2-プロピルエステルとした。これをCAG1と同様にメチル化およびメチルクロライドを行い、得られたヒドキシメチル誘導体をp-トルエンスルホンクロライドと反応させて、2-フェニル-2-(p-トルエンスルホンホルニルオキシ)-3-ケトブタン酸tert-ブチルエステル(CAG3)を得る。

【0066】(4)CAG3と同様に、p-トルエンスルホンホルニルクロライドの代わりにメタンスルホンクロライドを用いて、2-メチル-2-メタンスルホンホルニルオキシ-3-ケトブタン酸tert-ブチルエステル(CAG4)を得る。

【0067】(5)1-メチルシクロヘキサセンを酸化オキシウム存在下で酸化して1-メチル-1,2-ジヒドロキシヘキサセンを得る。これをトリエチルアミンの存在下でp-トルエンスルホンクロライドと反応させ、

(10)

17

シス-1-メチル-1-ヒドロキシ-2-(p-トルエンスルホンホルニルオキシ)ヘキサエン(CAG5)を得る。【0068】(6)ノルボルネン系酸化オキシウムの存在下で酸化してノルボルナジオールを得た。これをCAG5と同様に、p-トルエンスルホンホルニルクロライドと反応させ、2-ヒドロキシ-3-(p-トルエンスルホンホルニルオキシ)-エキソ-ペンチン[2,2,1]ヘプタン(CAG6)を得る。

【0069】(7)1S-(+)-α-ピネンを酸化オキシウムの存在下で酸化して1S-(+)-α-ピネンジオールを得た。これをCAG5と同様に、p-トルエンスルホンホルニルクロライドと反応させ、2-ヒドロキシ-3-(p-トルエンスルホンホルニルオキシ)-[1S,1a,2a,3a,5a]-2,6,6-トリメチルシクロ[3,1,1]ヘプタン(CAG7)を得る。

【0070】(8)2-メチル-3-ヒドロキシプロペンをトリフェニルホスフィンの存在下でtert-ブチルヒドロペルオキシドで酸化して、1,2-エポキシ-2-メチル-3-ヒドロキシプロパンを得た。これをトリエチルアミンの存在下でp-トルエンスルホンクロライドと反応させて、1,2-エポキシ-2-メチル-3-(p-トルエンスルホンホルニルオキシ)プロパン(CAG8)を得る。

【0071】(9)ベンゾイル酢酸エチルエステルをエチレングリコールによってケタール化してから、水素化リチウムアルミニウムで還元して3-フェニル-3,3-エチレンジオキシプロパノールとした。これをトリエチルアミンの存在下でp-トルエンスルホンクロライドと反応させて、1-(p-トルエンスルホンホルニルオキシ)-3-フェニル-3,3-エチレンジオキシプロパン(CAG9)を得る。

【0072】<実施例1>ビスフェノールA型エポキシ樹脂エポコート828(油化シエルエポキシ社製)10重量部、ジフェニル(p-フェニルチオフェニル)スルホニウムヘキサフルオロアンチモネート5重量部および2-メチル-2-(p-トルエンスルホンホルニルオキシ)ヘキサエン[表1]

実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5
CAG1 8	CAG2 10	CAG3 1	CAG4 12	CAG5 10
酸増殖剤 露光時間(秒)	酸増殖剤 露光時間(秒)	酸増殖剤 露光時間(秒)	酸増殖剤 露光時間(秒)	酸増殖剤 露光時間(秒)
比較例	比較例	比較例	比較例	比較例
CAG6 7	CAG7 10	CAG8 12	CAG9 15	なし 70
酸増殖剤 露光時間(秒)	酸増殖剤 露光時間(秒)	酸増殖剤 露光時間(秒)	酸増殖剤 露光時間(秒)	酸増殖剤 露光時間(秒)

【0075】<実施例10-18>実施例1〜9におけるビスフェノールA型エポキシ樹脂エポコート828(油化シエルエポキシ社製)代わりにエポキシ化合物C Y-179(日本チバガイギー社製：商品名)を用いる以外は実施例1〜9と同様にして光重合性組成物を作製し、光重合性組成物の硬化までの最小露光量を調べた。これらの結果を表2に示す。

【0076】

【表2】

18

*シ)-3-ケトブタン酸tert-ブチルエステル5重量部を2-ブタノン50重量部に混合溶解し、ガラス基板上に約5μmの膜厚になるように塗布、乾燥した。次に100W高圧水銀灯を用いて、露光を行った後、120℃で10分間加熱処理を施した。タルクの粉末を使用して表面がタックフリーになるまでの最小露光量を求めて確認した。8秒程度の露光後の加熱処理によって酸化被膜が形成されたのに対し、比較例としての酸増殖剤2-メチル-2-(p-トルエンスルホンホルニルオキシ)-3-ケトブタン酸tert-ブチルエステルを加えない組成物では70秒の光照射を必要とした。

【0073】<実施例2-9>実施例1における2-メチル-2-(p-トルエンスルホンホルニルオキシ)-3-ケトブタン酸tert-ブチルエステル(CAG1)の代わりに、2-メチル-2-メタンスルホンホルニルオキシ-3-ケトブタン酸tert-ブチルエステル(CAG2)、2-メチル-2-(p-トルエンスルホンホルニルオキシ)-3-ケトブタン酸tert-ブチルエステル(CAG3)、2-メチル-2-メタンスルホンホルニルオキシ-3-ケトブタン酸tert-ブチルエステル(CAG4)、シス-1-メチル-1-ヒドロキシ-2-(p-トルエンスルホンホルニルオキシ)ヘキサエン(CAG5)、2-ヒドロキシ-3-(p-トルエンスルホンホルニルオキシ)-2-ヒドロキシ-3-(p-トルエンスルホンホルニルオキシ)プロパン(CAG6)、2-ヒドロキシ-3-(p-トルエンスルホンホルニルオキシ)-[1S,1a,2a,3a,5a]-2,6,6-トリメチルシクロ[3,1,1]ヘプタン(CAG7)、1,2-エポキシ-2-メチル-3-(p-トルエンスルホンホルニルオキシ)プロパン(CAG8)および1-(p-トルエンスルホンホルニルオキシ)-3-フェニル-3,3-エチレンジオキシプロパン(CAG9)を用いる以外は実施例1と同様にして光重合性組成物を作製し、光重合性組成物の硬化までの最小露光量を調べた。これらの結果を表1に示す。

【0074】

【表1】

(11)

20

実施例10	実施例11	実施例12	実施例13	実施例14
ラジカル重合性モノマー	CAG1	CAG2	CAG3	CAG4
増粘剤	8	11	9	12
光時間(秒)	15	15	15	15
増粘率(%)	15	15	15	15
増粘率(%)	15	15	15	15

【0077】＜実施例19-23＞ビスフェノールA型エポキシ樹脂エポキシコート828（油化シエラエポキシ社製）代りに、グリシジルエーテル（E P 1）、エチレンジグリシジルエーテル（E P 2）、ビニルキシンロキシンベンゼン（V E 1）、ビス（p-ビニロキシエトキシフェニル）エーテル（V E 2）またはビニロキシトキシフェニル）エーテル（V E 3）を用いる以外は実施例1と同様にして光重合性組成物を作製し、光重合性組成物の硬化までの最小露光量を調べた。これらの結果を表3に示す。

【0078】

【表3】

実施例	19	20	21	22	23
カチオン重合性化合物	E P 1	E P 2	V E 1	V E 2	V E 3
増粘剤(%)	8	10	15	20	20
光時間(秒)	70	80	100	150	150
増粘率(%)	なし	なし	なし	なし	なし

【0079】＜実施例24-28＞実施例5において、ジフェニル（p-フェニル）オフェニル）スルホニウムヘキサフルオロアンチモネートの代わりに、ジフェニル（p-フェニル）オフェニル）スルホニウムヘキサフルオロアンチモネート（I N 1）、トリフェニルオロメタンスルホニウム（I N 2）、トリフェニルオロメタンスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート（I N 3）、ジフェニル（p-フェニル）オフェニル）スルホニウムヘキサフルオロアンチモネート（I N 4）またはジ-tert-ブチル

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

(12)

21

10分間加熱処理を施した。タルクの粉末を使用し表面がタックフリーになるまでの最小露光量を求めて感度とした。2秒程度の露光で後の加熱処理によって硬化被膜が形成されたのに対し、比較のため行った酸増粘剤2-メチル-2-(p-tert-ブチルエーテル)ホルネオキシ-3-ケトプロタン酸tert-ブチルエーテルを加えない組成物では50秒の光照射を必要とした。

【0084】＜実施例35＞エポキシ化合物C Y-17

9（日本チバガイギー社製）100重量部、ポリ（メチルメタクリレート）100重量部、トリフェニルホスホニウムヘキサフルオロアンチモネート5重量部、2-ヒドロキシ-3-(p-tert-ブチルエーテル)ホルネオキシ-エポキシ-ビニル [2, 2, 1] ヘプタン10重量部を酢酸エチル100重量部に混合溶解し、ガラス基板上に約5μmの膜厚になるように塗布、乾燥した。次に100W高圧水銀灯を用いて露光した後、120℃で10

【0085】

【発明の効果】本発明の光重合性組成物およびその重合方法によれば、感光速度を著しく向上させることが可能となる。またラジカル重合を組み合わせるハイブリッドな光重合性組成物とすることで、より感光速度の向上が期待される。すなわち本発明は、少量の化学作用放射線でも多くの膜を増殖させて、感光速度を著しく向上した光重合性組成物を提供することができる。

22

分間加熱処理を施した。タルクの粉末を使用し表面がタックフリーになるまでの最小露光量を求めて感度とした。10秒程度の露光で後の加熱処理によって硬化被膜が形成されたのに対し、比較として酸増粘剤2-メチル-2-(p-tert-ブチルエーテル)ホルネオキシ-3-ケトプロタン酸tert-ブチルエーテルを加えない組成物では100秒の光照射を必要とした。

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

閉鎖事項全部証明書

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
 コニカミノルタホールディングス株式会社
 会社法人等番号 0111-01-007050

商 号	<u>コニカ株式会社</u>	
	<u>コニカミノルタホールディングス株式会社</u>	平成15年 8月 5日変更
		平成15年 8月 5日登記
本 店	<u>東京都新宿区西新宿一丁目26番2号</u>	
公告をする方法	東京都に於て発行する日本経済新聞に掲載する	
会社成立の年月日	昭和11年12月22日	
目 的	<u>1. 写真機械及び附属品並びにその他の光学機械の製造及び販売</u> <u>2. 写真感光材料一般の製造及び販売</u> <u>3. 印刷用機械器具及び材料の製造及び販売</u> <u>4. 医薬品及び医薬部外品並びに医療用機械器具及び材料の製造及び販売</u> <u>5. 事務用機械器具及び材料の製造及び販売</u> <u>6. 計量器及び度量衡器の製造及び販売</u> <u>7. 工業薬品の製造及び販売</u> <u>8. 電気、電子及び磁気機械器具並びに材料の製造及び販売</u> <u>9. 合成化学製品の製造及び販売</u> <u>10. 精密機械及び工具類の製造及び販売</u> <u>11. 音声、映像等記録済媒体の販売及び賃貸</u> <u>12. 不動産の賃貸</u> <u>13. 前各号に附帯または関連する一切の業務</u>	
	<u>1. 写真機械及び附属品並びにその他の光学機械の製造及び販売</u> <u>2. 写真感光材料一般の製造及び販売</u> <u>3. 印刷用機械器具及び材料の製造及び販売</u> <u>4. 医薬品及び医薬部外品並びに医療用機械器具及び材料の製造及び販売</u> <u>5. 事務用機械器具及び材料の製造及び販売</u> <u>6. 計量器及び度量衡器の製造及び販売</u> <u>7. 工業薬品の製造及び販売</u> <u>8. 電気、電子及び磁気機械器具並びに材料の製造及び販売</u> <u>9. 合成化学製品の製造及び販売</u> <u>10. 精密機械及び工具類の製造及び販売</u> <u>11. 音声、映像等記録済媒体の販売及び賃貸</u> <u>12. 不動産の賃貸</u> <u>13. 前各号に附帯または関連する一切の業務</u>	
	<p>平成14年 8月14日更正</p> <u>1. 以下の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式または出資持分を保有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理</u> <u>イ. 写真機械及び附属品並びにその他の光学機械の製造及び販売</u> <u>ロ. 写真感光材料一般の製造及び販売</u>	

	<p>ハ. 印刷用機械器具及び材料の製造及び販売 ニ. 医薬品及び医薬部外品並びに医療用機械器具及び材料の製造及び販売 ホ. 事務用機械器具及び材料の製造及び販売 ヘ. 計量器及び度量衡器の製造及び販売 ト. 電気、電子及び磁気機械器具並びに材料の製造及び販売 チ. 精密機械及び工具類の製造及び販売 リ. 上記イ. 及びハ. からチ. までに関連するデバイス、部品等の製造及び販売 ス. 上記イ. からリ. までに関連するソフトウェアの開発及び販売並びに情報処理・提供サービス業 ル. 工業薬品の製造及び販売 ヲ. 合成化学製品の製造及び販売 ワ. 画像入出力技術、情報処理技術等に関連する技術の開発事業 カ. 上記イ. からワ. までに附帯または関連する一切の事業 2. 不動産の賃貸 3. 前各号に附帯または関連する一切の業務 平成15年 4月 1日変更 平成15年 4月 1日登記</p>
	<p>1 以下の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式または出資持分を保有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理 イ. 事務用機械器具及び材料の製造及び販売 ロ. 写真機械及び附属品並びにその他の光学機械器具、レンズ及び理化学機械器具の製造及び販売 ハ. 写真感光材料一般の製造及び販売 ニ. 印刷用機械器具及び材料の製造及び販売 ホ. 医薬品及び医薬部外品並びに医療用機械器具及び材料の製造及び販売 ヘ. 測定器、計量器及び度量衡器の製造及び販売 ト. 電気、電子、磁気及び通信機械器具並びに材料の製造及び販売 チ. 精密機械及び工具類の製造及び販売 リ. 上記イ. 及びロ. 、並びにニ. からチ. までに関連するデバイス、部品等の製造及び販売 ス. 上記イ. からリ. までに関連するソフトウェアの開発及び販売並びに情報処理・提供サービス業 ル. 工業薬品の製造及び販売 ヲ. 合成化学製品の製造及び販売 ワ. 画像入出力技術、情報処理技術等に関連する技術の開発事業 カ. 印刷業、製版業 コ. 上記ロ. に関連する建設工事の請負 タ. 上記イ. からリ. まで、並びにル. 及びヲ. に記載の製品の輸出入 レ. 上記イ. からタ. までに附帯または関連する一切の事業 2 不動産の賃貸 3 前各号に附帯または関連する一切の業務 平成15年 8月 5日変更 平成15年 8月 5日登記</p>
額面株式1株の金額	金50円
一単元の株式の数	1000株

東京都新宿区西新宿一丁目6番2号
 コニカミノルタホールディングス株式会社
 会社法人等番号 0111-01-007050

	500株	平成15年 8月 5日変更
		平成15年 8月 5日登記
発行する株式の総数	8億株	
	12億株	平成15年 8月 5日変更
		平成15年 8月 5日登記
発行済株式の総数 並びに種類及び数	発行済株式の総数 3億5765万5368株	
	発行済株式の総数 5億3166万4337株	平成15年 8月 5日変更
		平成15年 8月 5日登記
資本の額	金375億1934万3528円	
名義書換代理人の 氏名及び住所並び に営業所	東京都千代田区丸の内一丁目4番3号 東洋信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番3号 東洋信託銀行株式会社 証券代行部	
	東京都千代田区丸の内一丁目4番3号 ユーエフジェイ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番3号 ユーエフジェイ信託銀行株式会社 証券代行部 平成14年 1月15日変更	平成14年 1月15日登記
役員に関する事項	取締役 井手 恵 生	平成 7年 6月29日重任
	取締役 井手 恵 生	平成 9年 6月27日重任
		平成 9年 7月 4日登記
	取締役 井手 恵 生	平成11年 6月29日重任
		平成11年 7月12日登記
		平成13年 6月28日退任
		平成13年 7月11日登記
	取締役 植松 富 司	平成 7年 6月29日重任

東京都新宿区西新宿一丁目2番2号
 コニカミノルタホールディングス株式会社
 会社法人等番号 0111-01-007050

	<u>取締役</u> 植松 富司	平成 9 年 6 月 2 7 日重任
		平成 9 年 7 月 4 日登記
		平成 1 1 年 6 月 2 9 日重任
		平成 1 1 年 7 月 1 2 日登記
		平成 1 3 年 6 月 2 8 日重任
		平成 1 3 年 7 月 1 1 日登記
	<u>取締役</u> 植松 富司	平成 1 5 年 6 月 2 5 日重任
		平成 1 5 年 7 月 9 日登記
	<u>取締役</u> 岡島 進一郎	平成 7 年 6 月 2 9 日重任
		平成 9 年 6 月 2 7 日重任
		平成 9 年 7 月 4 日登記
		平成 1 1 年 6 月 2 9 日重任
		平成 1 1 年 7 月 1 2 日登記
		平成 1 3 年 6 月 2 8 日退任
		平成 1 3 年 7 月 1 1 日登記
	<u>取締役</u> 松沢 勝	平成 7 年 6 月 2 9 日重任
		平成 9 年 6 月 2 7 日重任
		平成 9 年 7 月 4 日登記
		平成 1 1 年 6 月 2 9 日重任
		平成 1 1 年 7 月 1 2 日登記
		平成 1 3 年 6 月 2 8 日退任
		平成 1 3 年 7 月 1 1 日登記
	<u>取締役</u> 久保田 英夫	平成 7 年 6 月 2 9 日就任

		平成 9 年 6 月 2 7 日退任
		平成 9 年 7 月 4 日登記
	取締役 米 山 高 範	平成 8 年 6 月 2 7 日重任
	取締役 米 山 高 範	平成 1 0 年 6 月 2 6 日重任
		平成 1 0 年 7 月 3 日登記
	取締役 米 山 高 範	平成 1 2 年 6 月 2 9 日重任
		平成 1 2 年 7 月 1 3 日登記
	取締役 米 山 高 範	平成 1 4 年 6 月 2 5 日重任
		平成 1 4 年 7 月 8 日登記
		平成 1 5 年 6 月 2 5 日退任
		平成 1 5 年 7 月 9 日登記
	取締役 岩 居 文 雄	平成 8 年 6 月 2 7 日重任
	取締役 岩 居 文 雄	平成 1 0 年 6 月 2 6 日重任
		平成 1 0 年 7 月 3 日登記
	取締役 岩 居 文 雄	平成 1 2 年 6 月 2 9 日重任
		平成 1 2 年 7 月 1 3 日登記
	取締役 岩 居 文 雄	平成 1 4 年 6 月 2 5 日重任
		平成 1 4 年 7 月 8 日登記
	取締役 岩 居 文 雄	平成 1 5 年 6 月 2 5 日重任
		平成 1 5 年 7 月 9 日登記
	取締役 小 宮 衛	平成 8 年 6 月 2 7 日重任
	取締役 小 宮 衛	小宮衛の名
		平成 1 0 年 3 月 2 0 日更正

東京都新宿区西新宿一丁目2番2号
 コニカミノルタホールディングス株式会社
 会社法人等番号 0111-01-007050

	<u>取締役</u>	<u>小 宮 衛</u>	平成10年 6月26日重任
			平成10年 7月 3日登記
	<u>取締役</u>	<u>小 宮 衛</u>	平成12年 6月29日重任
			平成12年 7月13日登記
			平成14年 6月25日退任
			平成14年 7月 8日登記
	<u>取締役</u>	<u>小 板 橋 洸 夫</u>	平成 8年 6月27日重任
	<u>取締役</u>	<u>小 板 橋 洸 夫</u>	平成10年 6月26日重任
			平成10年 7月 3日登記
	<u>取締役</u>	<u>小 板 橋 洸 夫</u>	平成12年 6月29日重任
			平成12年 7月13日登記
	<u>取締役</u>	<u>小 板 橋 洸 夫</u>	平成14年 6月25日重任
			平成14年 7月 8日登記
	<u>取締役</u>	<u>小 板 橋 洸 夫</u>	平成15年 6月25日重任
			平成15年 7月 9日登記
	<u>取締役</u>	<u>鮫 島 弘 吉 郎</u>	平成 8年 6月27日重任
	<u>取締役</u>	<u>鮫 島 弘 吉 郎</u>	平成10年 6月26日重任
			平成10年 7月 3日登記
			平成12年 6月29日退任
			平成12年 7月13日登記
	<u>取締役</u>	<u>鈴 木 繁</u>	平成 8年 6月27日重任
	<u>取締役</u>	<u>鈴 木 繁</u>	平成10年 6月26日重任
			平成10年 7月 3日登記

東京都新宿区西新宿一丁目2番2号
 コニカミノルタホールディングス株式会社
 会社法人等番号 0111-01-007050

	<u>取締役</u> 鈴木 繁	平成12年 6月29日重任
		平成12年 7月13日登記
		平成14年 6月25日退任
		平成14年 7月 8日登記
	<u>取締役</u> 森 藤 幸 男	平成 8年 6月27日重任
	<u>取締役</u> 森 藤 幸 男	平成10年 6月26日重任
		平成10年 7月 3日登記
		平成12年 6月29日退任
		平成12年 7月13日登記
	<u>取締役</u> 伊 藤 國 雄	平成 8年 6月27日重任
	<u>取締役</u> 伊 藤 國 雄	平成10年 6月26日重任
		平成10年 7月 3日登記
		平成12年 6月29日退任
		平成12年 7月13日登記
	<u>取締役</u> 松 本 政 之	平成 8年 6月27日重任
		平成10年 6月26日退任
		平成10年 7月 3日登記
	<u>取締役</u> 新 谷 恭 將	平成 8年 6月27日就任
	<u>取締役</u> 新 谷 恭 將	平成10年 6月26日重任
		平成10年 7月 3日登記
	<u>取締役</u> 新 谷 恭 將	平成12年 6月29日重任
		平成12年 7月13日登記

		平成14年 6月25日退任
		平成14年 7月 8日登記
	<u>取締役</u> 神 戸 勝	平成 8年 6月27日就任
	<u>取締役</u> 神 戸 勝	平成10年 6月26日重任
		平成10年 7月 3日登記
	<u>取締役</u> 神 戸 勝	平成12年 6月29日重任
		平成12年 7月13日登記
	<u>取締役</u> 神 戸 勝	平成14年 6月25日重任
		平成14年 7月 8日登記
	<u>取締役</u> 神 戸 勝	平成15年 6月25日重任
		平成15年 7月 9日登記
	<u>取締役</u> 芳 西 哲	平成 8年 6月27日就任
	<u>取締役</u> 芳 西 哲	平成10年 6月26日重任
		平成10年 7月 3日登記
		平成12年 6月29日退任
		平成12年 7月13日登記
	<u>取締役</u> 石 河 正 則	平成 8年 6月27日就任
	<u>取締役</u> 石 河 正 則	平成10年 6月26日重任
		平成10年 7月 3日登記
		平成12年 6月29日退任
		平成12年 7月13日登記
	<u>取締役</u> 日 比 野 繁 雄	平成 8年 6月27日就任

	<u>取締役</u> 日比野 繁雄	平成10年 6月26日重任
		平成10年 7月 3日登記
		平成12年 6月29日退任
		平成12年 7月13日登記
	<u>取締役</u> 宮地 剛	平成14年 6月25日就任
		平成14年 7月 8日登記
		平成15年 6月25日退任
		平成15年 7月 9日登記
	<u>取締役</u> 染谷 義彦	平成14年 6月25日就任
		平成14年 7月 8日登記
		平成15年 6月25日退任
		平成15年 7月 9日登記
	<u>取締役</u> 片田 哲也	平成14年 6月25日就任
		平成14年 7月 8日登記
	<u>取締役</u> 片田 哲也 (社外取締役)	平成15年 6月25日重任
		平成15年 7月 9日登記
	<u>取締役</u> 藤村 宏幸	平成14年 6月25日就任
		平成14年 7月 8日登記
	<u>取締役</u> 藤村 宏幸 (社外取締役)	平成15年 6月25日重任
		平成15年 7月 9日登記
	<u>取締役</u> 藤原 菊男 (社外取締役)	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
	<u>取締役</u> 井上 礼之 (社外取締役)	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
	<u>取締役</u> 太田 義勝	平成15年 8月 5日就任
		平成15年 8月 5日登記

	取締役 東山善彦	平成15年 8月 5日就任
		平成15年 8月 5日登記
	取締役 田嶋紀雄	平成15年 8月 5日就任
		平成15年 8月 5日登記
	取締役 本藤正則	平成15年 8月 5日就任
		平成15年 8月 5日登記
	<u>神奈川県横浜市青葉区たちばな台一丁目7番地24</u> 代表取締役 植松富司 <u>神奈川県横浜市青葉区たちばな台一丁目7番地24</u> 代表取締役 植松富司 <u>神奈川県横浜市青葉区たちばな台一丁目7番地24</u> 代表取締役 植松富司 <u>神奈川県横浜市青葉区たちばな台一丁目7番地24</u> 代表取締役 植松富司	平成 7年 6月29日重任
		平成 9年 6月27日重任
		平成 9年 7月 4日登記
		平成11年 6月29日重任
		平成11年 7月12日登記
		平成13年 6月28日重任
		平成13年 7月11日登記
	<u>東京都町田市東玉川学園一丁目22番8号</u> 代表取締役 米山高範 <u>東京都町田市東玉川学園一丁目22番8号</u> 代表取締役 米山高範 <u>東京都町田市東玉川学園一丁目22番8号</u> 代表取締役 米山高範	平成15年 6月25日退任
		平成15年 7月 9日登記
		平成 8年 6月27日重任
		平成10年 6月26日重任
		平成10年 7月 3日登記
	<u>東京都稲城市坂浜539番地</u> 代表取締役 岩居文雄	平成12年 6月29日就任
		平成12年 7月13日登記
		平成12年 6月29日重任
		平成12年 7月13日登記

東京都新宿区西新宿一丁目2番2号
 コニカミノルタホールディングス株式会社
 会社法人等番号 0111-01-007050

	東京都稲城市坂浜539番地 代表取締役 岩 居 文 雄	平成14年 6月25日重任
		平成14年 7月 8日登記
		平成15年 6月25日退任
		平成15年 7月 9日登記
	監査役 永 井 徹	平成 6年 6月29日重任
		平成 9年 6月27日重任
		平成 9年 7月 4日登記
	監査役 永 井 徹	平成12年 6月29日退任
		平成12年 7月13日登記
	監査役 渡 辺 輝 之	平成 6年 6月29日重任
		平成 9年 6月27日退任
		平成 9年 7月 4日登記
	監査役 熊 谷 善 衛	平成 6年 6月29日就任
		平成 9年 6月27日重任
		平成 9年 7月 4日登記
		平成10年 6月26日辞任
		平成10年 7月 3日登記
	監査役 熊 谷 善 衛	平成 6年 6月29日就任
		平成 9年 6月27日退任
		平成 9年 7月 4日登記
	監査役 若 原 泰 之	平成 9年 6月27日就任
		平成 9年 7月 4日登記
	監査役 久 保 田 英 夫	平成 9年 6月27日就任
		平成 9年 7月 4日登記

	<u>監査役</u> 久保田英夫	平成12年 6月29日重任
		平成12年 7月13日登記
		平成15年 6月25日退任
		平成15年 7月 9日登記
	<u>監査役</u> 神崎安太郎	平成 9年 6月27日就任
		平成 9年 7月 4日登記
		平成12年 6月29日退任
		平成12年 7月13日登記
	<u>監査役</u> 松本政之	平成10年 6月26日就任
		平成10年 7月 3日登記
	<u>監査役</u> 松本政之	平成12年 6月29日重任
		平成12年 7月13日登記
		平成15年 6月25日退任
		平成15年 7月 9日登記
	<u>監査役</u> 若原泰之	平成12年 6月29日就任
		平成12年 7月13日登記
		平成15年 6月25日退任
		平成15年 7月 9日登記
	<u>監査役</u> 加藤一和	平成12年 6月29日就任
		平成12年 7月13日登記
		平成15年 6月25日退任
		平成15年 7月 9日登記
	指名委員 井上礼之	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
	指名委員 片田哲也	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記

	指名委員 藤原 菊 男	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
	指名委員 小 板 橋 洸 夫	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
	指名委員 東 山 善 彦	平成15年 8月 5日就任
		平成15年 8月 5日登記
	監査委員 片 田 哲 也	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
	監査委員 藤 村 宏 幸	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
	監査委員 藤 原 菊 男	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
	監査委員 小 板 橋 洸 夫	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
	監査委員 東 山 善 彦	平成15年 8月 5日就任
		平成15年 8月 5日登記
	報酬委員 藤 村 宏 幸	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
	報酬委員 藤 原 菊 男	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
	報酬委員 井 上 礼 之	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
	報酬委員 小 板 橋 洸 夫	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
	報酬委員 東 山 善 彦	平成15年 8月 5日就任
		平成15年 8月 5日登記

東京都新宿区西新宿一丁目2番2号
 コニカミノルタホールディングス株式会社
 会社法人等番号 0111-01-007050

執行役	岩 居 文 雄	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
執行役	神 戸 勝	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
執行役	新 谷 恭 将	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
執行役	坂 口 洋 文	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
執行役	岩 間 秀 彬	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
執行役	河 浦 照 男	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
執行役	宮 地 剛	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
執行役	染 谷 義 彦	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
執行役	齋 藤 知 久	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
執行役	佐 田 泰 業	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
執行役	小 野 寺 薫	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
執行役	堀 利 文	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
執行役	松 丸 隆	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記

東京都新宿区西新宿一丁目2番2号
 コニカミノルタホールディングス株式会社
 会社法人等番号 0111-01-007050

執行役	太田 義勝	平成15年 8月 5日就任
		平成15年 8月 5日登記
執行役	田嶋 紀雄	平成15年 8月 5日就任
		平成15年 8月 5日登記
執行役	本藤 正則	平成15年 8月 5日就任
		平成15年 8月 5日登記
執行役	石河 宏	平成15年 8月 5日就任
		平成15年 8月 5日登記
執行役	石原 俊昭	平成15年 8月 5日就任
		平成15年 8月 5日登記
執行役	大浦 三治	平成15年 8月 5日就任
		平成15年 8月 5日登記
執行役	大場 勝	平成15年 8月 5日就任
		平成15年 8月 5日登記
執行役	河野 盾臣	平成15年 8月 5日就任
		平成15年 8月 5日登記
執行役	関 誠之	平成15年 8月 5日就任
		平成15年 8月 5日登記
執行役	武木 田義祐	平成15年 8月 5日就任
		平成15年 8月 5日登記
執行役	藤井 博	平成15年 8月 5日就任
		平成15年 8月 5日登記
執行役	古川 博	平成15年 8月 5日就任
		平成15年 8月 5日登記
執行役	山名 昌衛	平成15年 8月 5日就任
		平成15年 8月 5日登記

	東京都稲城市坂浜539番地 代表執行役 岩 居 文 雄	平成15年 6月25日就任
		平成15年 7月 9日登記
	京都府京都市上京区衣棚通樫木町上る門跡町2 86番地 代表執行役 太 田 義 勝	平成15年 8月 5日就任
		平成15年 8月 5日登記
	<u>取締役片田哲也は社外取締役である</u>	
		平成14年 7月 8日登記
		平成15年 6月25日退任 により抹消
		平成15年 7月 9日登記
取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定	当会社は、商法特例法第21条の17第4項の規定により、取締役会の決議をもって、同条第1項の行為に関する取締役（取締役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる。 平成15年 6月25日設定 平成15年 7月 9日登記	
		当会社は、商法特例法第21条の17第6項の規定により、取締役会の決議をもって、同条第1項の行為に関する執行役（執行役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる。 平成15年 6月25日設定 平成15年 7月 9日登記
社外取締役の会社に対する責任の制限に関する規定	当会社は、社外取締役（商法第188条第2項第7号ノ2に規定する社外取締役をいう。以下同じ。）との間で、商法特例法第21条の17第5項の規定により、その取締役の同条第1項の行為に関する損害賠償責任を法令の限度において限定する契約を締結することができる。 平成15年 6月25日設定 平成15年 7月 9日登記	
会社分割	平成14年10月1日埼玉県狭山市大字上広瀬591番地の7コニカテクノプロダクト株式会社に分割 平成14年10月 9日登記	
	平成15年4月1日東京都新宿区西新宿一丁目26番2号コニカフォトライメージ株式会社に分割 平成15年 4月 1日登記	

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
コニミノルタホールディングス株式会社
会社法人等番号 0111-01-007050

	平成15年4月1日東京都新宿区西新宿一丁目26番2号コニカメディカルア ンドグラフィック株式会社に分割 平成15年 4月 1日登記
	平成15年4月1日東京都新宿区西新宿一丁目26番2号コニカビジネステク ノロジーズ株式会社に分割 平成15年 4月 1日登記
	平成15年4月1日東京都新宿区西新宿一丁目26番2号コニカオプト株式会 社に分割 平成15年 4月 1日登記
	平成15年4月1日東京都新宿区西新宿一丁目26番2号コニカテクノロジー センター株式会社に分割 平成15年 4月 1日登記
	平成15年4月1日東京都新宿区西新宿一丁目26番2号コニカビジネスエキ スパート株式会社に分割 平成15年 4月 1日登記
委員会等設置会社 に関する事項	委員会等設置会社 平成15年 6月25日設定 平成15年 7月 9日登記
登記記録に関する 事項	平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により 平成 9年 2月20日移記
	平成15年8月25日東京都千代田区丸の内一丁目6番1号に本店移転 平成15年 9月 4日登記 平成15年 9月 4日閉鎖

これは登記簿に記録されている閉鎖された事項の全部であることを証明した書
面である。

(東京法務局新宿出張所管轄)

平成17年 3月18日

東京法務局
登記官

吉 岡 誠



整理番号 ス555438

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

17/17